## 國立成功大學 基礎研究核心設施 多功能 X 光薄膜繞射儀使用申請實驗記錄表

				使用日期:年月日	
使用者			指導教授/單位		
預約序號	BSXRD001900		使用者電話		
樣品組成			使用者 E-mail		
選用分析	□ 低掠角薄膜繞射 □ 殘留		應力分析	□ 極圖分析	
方式	☐ Rcoking Curve ☐ Refle		ectivity	☐ Microarea / Diffraction	
1. 殘留應力分析:			4. Rocking Curve:	2Theta fromto	
高角度繞射位置 2Thetahkl,			請描繪磊晶層數,組成成分,大約厚度(nm)		
格子常數:a b c			5. Reflectivity:		
Alpha: Beta: Garma:			請描繪詳細結構圖,組成元素,組成密度(g/cm³)及鍍層		
Young's modul:MPa, Poission ratio:			大約厚度(nm):		
2. 極圖分析:繞射位置 2Theta					
3. 低掠角薄膜繞射:2Theta fromto					
入射角度:					
掃描方式:					
1. Step scan					
()degree/step ()sec/step  2.  Continuous scan					
#描速度:()/min					
實驗檔案名稱:					
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
				儀器代碼: XRD001900	
備註:			Multipurpose High intensity X-Ray Thin-Film Micro Area Diffractometer (XRD001900) belonging to the Core Facility Center of		
交件日期: 年 月 日 寄出		U	National Cheng Kung University		